

Плазменное технологическое устройство содержит вакуумную камеру с системой запуска и контроля газов, в верхней части которой осесимметрично расположено диэлектрическое окно с антенной, которая соединена с ВЧ генератором через устройство согласования, в нижней части камеры расположен держатель с подкладкой, с возможностью подключения к источнику питания, снаружи камера охвачена магнитной системой из двух соленоидальных элементов. В пространстве между диэлектрическим окном и подкладкой осесимметрично установлен цилиндрический полый электрод, диаметр которого определяют из соотношения. При этом его высота определяется укороченной длиной волны основной частоты в плазме, а расстояние между плоскостью подложки и выходным срезом цилиндрического полого электрода устанавливается по соотношению.